科学研究費助成事業

研究成果報告書

科研費

平成 28年 6月 22 日現在

機関番号: 34416 研究種目: 挑戦的萌芽研究 研究期間: 2014~2015 課題番号: 26630355 研究課題名(和文)光化学反応を利用した細胞培養器の開発

研究課題名(英文)Development of photo-responsive cell culture vessels using photochemical reactions

研究代表者

上田 正人(Ueda, Masato)

関西大学・化学生命工学部・准教授

研究者番号:40362660

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,000,000円

研究成果の概要(和文):(a) Ti,(b) Si02基板上にTi02を成膜した培養器を作製した。培養器(a)に骨芽細胞を播種 し,紫外光(UV)の連続照射と断続照射を行った。連続照射では細胞数が減少した。Ti02では,上方からの直接照射によ るダメージに加え,基板の光化学反応による効果が重畳した。一方,断続照射では細胞数は増加した。UV照射による水 酸基密度の上昇によると推察した。培養器(b)では光を照射するとTi02でUVが完全に吸収された。培養器に接着した細 胞は,UV照射によって剥離した。Ti02の光化学反応を利用することで,細胞の接着を促進・抑制したり,接着している 細胞を剥離したりできる可能性が実験的に示された。

研究成果の概要(英文): Anatase-type TiO2 is an n-type semiconductor which displays a high photocatalytic activity under ultraviolet (UV) irradiation. The purpose of this work was to develop photo-responsive cell culture vessels using the TiO2 film and to investigate the adhesion/proliferation behaviour of cells on them. Two types of vessels with following structures were prepared; TiO2 film on (a) pure Ti and (b) SiO2 substrates. Osteoblasts were incubated for 4-72 h. During the incubation, the UV irradiation was applied continuously or intermittently for 1 h just after the seeding and every 24 hours from upper side. The cells drastically decreased under continuous UV irradiation. Cells were damaged by the direct UV. In addition, the effect of photochemical reaction from the TiO2 might be superimposed on the cells. In contrast, the number of cells was increased by the intermittent irradiation. The cells could be detached from the vessel by the UV irradiation after adhesion.

研究分野: 材料物性学

キーワード: 生体材料 光化学反応 細胞

1. 研究開始当初の背景

近年,各種デバイス表面の生体機能を制御す る研究が盛んに行われている。研究代表者もチ タン製インプラント表面の骨伝導を促進・抑制す るための表面修飾法について研究を行っている。 具体的には,骨伝導を促進,抑制するとされる TiO₂, ZrO₂をそれぞれ金属表面に合成している。 その中で,表面の生体機能は合成プロセスに よっても変化することが明らかとなった。このよう な生体反応は,特に毒性の強い物質を除き,物 質そのものだけではなく,材料表面の電気的 チャージ,官能基やその密度に強く支配されて いると考えている。

光触媒や湿式太陽電池は半導体/水溶液界面 でのバンドベンディング,光励起電荷の分離, 表面の電気的チャージや官能基密度変化を巧 妙に利用している。これらの現象は上述した生 体機能を支配していると考えている因子と同じで ある。そこで,この光化学反応を生体材料にお ける表面状態を制御するツール,さらには生体 機能の切換トリガー(スイッチ)とし利用できない かと考えた。そこで,研究代表者は,純チタン基 板に合成した TiO₂ 膜に擬似体液中で紫外線 (UV)照射を行った。UV 照射の有無でリン酸カ ルシウムの析出形態が顕著に変化し,生体機能 を制御できる可能性が示唆された[M. Ueda, T. Kinoshita, M. Ikeda and M. Ogawa, *Mater. Sci. Eng. C*, 29, 2009, 2246-2249]。

細胞の初期接着,増殖挙動もデバイス表面の 電気的チャージや官能基の影響を強く受けると 予想される。これらの因子を光照射によって非 接触で制御できれば,細胞に関連する新たな生 体機能の制御ツールとなり,新たな観点からの 生体用デバイスの開発に繋がると考えた。

2.研究の目的

光応答性を有する機能性セラミックス膜上に細胞を播種し、光照射を行うことで、細胞の振る舞いに及ぼす光化学反応の影響を調査することを目的とした。具体的には下記事項を検討した。

- 純 Ti 基板, 合成 SiO₂ 基板上への光応答セ ラミックス膜の合成
- (2) 基板の光応答と細胞の接着・増殖挙動
- (3) 光応答セラミックスへの不純物ドーピング

3. 研究の方法

(1) 光応答セラミックス膜の合成

純 Ti 基板への TiO₂ 膜の合成

純 Ti 板を 80°C に保持した 5 M H₂O₂/0.1 M HNO₃ 混合水溶液に 20min 浸漬することで化学 処理を施した。引き続き, テフロン容器中で 1 M NH₃ 水溶液に浸漬し, 180°C-12 h の水熱処理を 施した。さらに, 大気中で 400°C -30min の熱処 理を施した。

合成 SiO₂ 基板への TiO₂ 膜の合成

合成 SiO₂ 基板 (20×20×t1 mm) に Ti(OC₃H₇)₄ を原料としたブル・ゲル法により TiO₂ 膜を合成し た。コーティング溶液の調製スキームは Fig.1 の 通り。基板中心部にコーティング溶液を 0.2 mL 滴下し、1000~5000 rpm で 30 s 回転させるスピ ンコーティングを行った。引き続き、大気中で 5 min 乾燥させ、400°C -30 min の熱処理を施し た。



Fig.1 コーティング溶液の調製スキーム

③ 合成膜のキャラクタリゼーション

外観・表面観察は、汎用型デジタルカメラ, SPM (SPM-9600)で、合成物質の同定は、 TF-XRD (RINT-2500, Incident ang.=1°)で行っ た。酸化物膜の光応答性は、ブラックライト (λ=254 nm, 2020 μW/cm²)とポテンシオスタット (HZ-5000)を使用し、リニアスィープボルタンメト リーで光電流を測定すること、ならびに自然電位 を測定することで評価した。Pt 対極、Ag/AgCl参 照電極、電解液には Hanks 溶液を用いた。

(2) 細胞の接着・増殖挙動

マウス由来初代骨芽細胞を各試料に播種し, 37°C で培養した。この培養中, ブラックライト (λ=365 nm, 2000 mW/cm²), または Xe ランプ (150 W)を用いて, TiO₂/Ti では上方から, TiO₂/SiO₂では下方から光を照射した。

細胞数は、WST 法,ならびにギムザ染色を施 した後,光学顕微鏡でカウントした。また,免疫 染色を行い,接着斑数も評価した。細胞の大き さや周囲長等は ImageJ[Rasband, W.S., ImageJ, U. S. National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA, http://rsb.info.nih.gov/ij/, 1997-2012]を利用して測定した。

(3) 光応答セラミックスへの不純物ドーピング

TiO₂ 膜を合成するためのコーティング溶液に おいて添加した濃硝酸の代わりに, NbCl₅ を溶 解した濃塩酸を加え, コーティング溶液とした。 コーティング方法, 焼成方法は上述した通り。

4. 研究成果

- (1) 光応答セラミックス膜の合成
- 純 Ti 基板への TiO, 膜の合成

化学処理と水熱処理による表面修飾後の試料 外観とSEM像をFig.2に示す。試料は干渉色を 呈し、非常に薄い膜が均一に合成されたことを 示している。その膜は、一辺が約40nmの立方 体状の結晶で構成されていることがわかる。



Fig.2 化学・水熱処理を施した純チタン試料の (a) 外観と(b) SEM 像

合成膜の XRD プルファイルを Fig.3 に示す。 アナターゼ型 TiO₂ のシャープなピークが観察され,低温処理にもかかわらず,結晶性の高い TiO₂ が合成されたことがわかる。また,この構造 は 400 °C-1h の熱処理後も維持された。





リニアスイープボルタンメトリーによって試料の 光応答性を調査した。UV を照射すると光電流 が発生し、その応答は非常にシャープであること がわかった(Fig.4)。このように純 Ti 上に合成し たTiO2 膜は、UV 照射に対して非常に敏感に応 答するデバイスであると言える。



② 合成 SiO₂基板への TiO₂ 膜の合成

回転数が 1000rpm, 2000rpm でスピンコーティ ングを行うと、合成膜は無色透明ではなく、白濁 した。回転数が 3000 rpm 以上になると無色透明 となり、均一な膜が合成された(Fig.5)。また、膜 厚は約 100 nm、表面粗さは Ra=0.4 nm であっ た。3000 rpm 以上では、回転数を増加させたと しても、その膜の表面形態、膜厚等に大きな変 化が認められなかっため、以降、回転数は 3000 rpm とした。



Fig.5 Sol-gel 法でガラス上に TiO₂を成膜した 試料の(a) 外観と(b) SPM 像

SiO₂ 基板とSiO₂ 基板上にTiO₂を成膜した試料の光透過スペクトルをFig.6に示す。SiO₂ 基板では、測定した全波長域の光がほぼ完全に透過した。それに対して、TiO₂ を成膜した試料では、波長が約380 nm以上の光が透過した。すなわち、UV はTiO₂ 膜でほぼ完全に吸収されたことがわかる。

SiO₂ 基板上に TiO₂を成膜し, SiO₂ 側から光を 照射すると TiO₂ 膜表面に透過する光は可視光 のみである。TiO₂ 表面で細胞を培養し, SiO₂ 側 から UV を含む光を照射したとしても, 細胞には その UV が照射されない。



Fig.6 合成 SiO₂ 基板上に合成した TiO₂ 膜に おける光透過スペクトル

リニアスイープボルタンメトリーによってガラス 基板上に TiO₂を成膜した試料の光応答性を調 査した。なお、この測定では、ガラス基板に透明 電極である ITO を成膜した SiO₂板を用いた。純 Ti 上に合成した TiO₂膜(Fig.4)と同様、UV を照 射すると明瞭に光電流が発生し、その応答は非 常にシャープであることがわかった(Fig.7)。この ように SiO₂ 基板上に合成した TiO₂膜も、光照射 に対して非常に敏感に応答するデバイスである と言える。



 Fig.7 合成 SiO2 基板上に合成した TiO2 膜で

 発生した光電流

(2) 細胞の接着・増殖挙動

純 Ti 基板上に合成した TiO₂ 膜における細胞の接着・増殖挙動(UV:上方からの照射)

過去の研究で,純 Ti や化学・水熱複合処理で 合成した TiO₂ 表面では,単調に細胞が増殖す ることがわかっている。

Fig.8は, (a) 連続照射, (b) 断続照射(播種後 1hのみ照射)下で4h培養した細胞をギムザ染 色し,光学顕微鏡を使用したカウントで求めた細 胞密度である。なお,細胞密度は,暗所下の Ti における細胞密度で規格化した。UV の連続照 射下では, 純 Ti, TiO2で共に細胞密度は減少し た(Fig.8(a))。これは, 基板への細胞接着が抑 制されたことを示している。UV は上方から照射 したため、細胞にも直接照射された。これにより 細胞はダメージを受け, 基板への接着が暗所下 に比べ抑制されたと推察している。一方, TiO2 では, Student-t 検定によって, その減少が有意 であることが示された。細胞へのUV 直接照射の 効果に加え, TiO, 表面で生じた光化学反応が 重畳したと考えている。一方, UV の予備(断続) 照射下では,純 Ti, TiO,で共に細胞密度は増 加した(Fig.8(b))。 TiO2 に UV が照射されると, 表面には光励起された正孔が集まり, 正に帯電 する。また、表面の水酸基密度が上昇することが 知られている。これらの現象により、タンパク質の 吸着が促進され,結果として細胞の接着も促進 されたと推察している。純 Ti も表面は非常に薄 い酸化物で覆われているため, TiO, と同様, 細 胞密度の上昇が観察されたと考えている。

断続照射下で4h,48h,72h培養した細胞密 度をFig.9に示す。これらはWSTで求めた。PS は試料なしを意味する。このPSにおいては、短 時間のUV照射によっても、細胞密度はわずか に減少する傾向が認められ、いずれの培養時間 でもその傾向は同じであった。これは、UVの直 接照射が細胞にダメージを与えていることを意 味する。それに対して、4h培養においては、UV の予備照射によって、TiならびにTiO2上では、 細胞密度が上昇した。これはギムザ染色後、光 学顕微鏡でカウントした結果(Fig.8(b))と同様の 傾向である。さらに、ここでTiO2における増加は 有意であった。UVの直接照射が細胞に与える ダメージを上回るポジティブな効果がTiO2上で 発生したことを示唆している。48 h,72 h 培養で は、UV 断続照射においても、単調に増殖した が、UV 照射の方が暗所下に比べ、わずかに低 い値を示した。培養時間に比べて UV の照射時 間は短いが、過剰照射は細胞の増殖抑制に繋 がることを示している。UV 照射によって、細胞の 増殖を促進させるには、最初の1 h のみ照射す る方法が効果的である可能性が高い。



Fig.8 UV の(a) 連続照射, (b) 予備(断続)照射 下で4h 培養された細胞数



暗所, UV の連続・断続照射下で4h培養した 細胞の免疫染色像を Fig.10 に示す。アクチン (細胞骨格を形成するタンパク質のうちのひと つ), ビンキュリン(細胞接着に関するタンパク 質), 核がそれぞれ緑, 赤, 青に染色されている。 UV の連続照射では, 細胞密度が減少するだけ ではなく, アポトーシスの前兆である細胞の収縮 も観察された。これらの像から,各細胞における 接着斑数(n),周囲長(d),細胞サイズ(D,長手 方向)を測定し,細胞サイズで規格化した隣接 接着斑距離($d(nD)^{-1}$)を求めた(Fig.11)。TiO₂に おいて,UVの連続照射では隣接接着斑距離が 暗所下のそれに比べて若干増加する傾向が認 められた。これは、UV 照射下のTiO₂表面には, 細胞が接着しにくいことを示していると考えてい る(Fig.11(a))。一方、断続照射では、暗所下, UV 照射でほとんど変化が認められなかった (Fig.11(b))。



Fig.10 暗所, UV の連続・断続照射下で 4h 培養した細胞の免疫染色像



Fig.11 UV の連続・断続照射下で培養された 細胞において細胞サイズで規格化した 接着斑間距離

② 合成 SiO₂ 基板上へ合成した TiO₂ 膜における細胞の接着・増殖挙動(UV:下方からの照射)

SiO₂基板にTiO₂を成膜した細胞培養器に,細胞をTiO₂表面に播種し,SiO₂側からUVを連続的に照射しながら4h培養した細胞のギムザ染色像をFig.12に示す。SiO₂では,暗所下においても接着細胞数は非常に少なかったが,SiO₂,TiO₂共にUVの連続照射によって,接着細胞数は減少した。SiO₂では,下方から照射したUVが吸収されることなく細胞に照射されるため,細胞はダメージを受け,接着細胞数が減少したと思われる。それに対し,TiO₂/SiO₂では,TiO₂膜でUVが吸収されるため,細胞へは可視光しか透過しない。それにもかかわらず細胞が接着していなかったので,この減少はTiO₂の光化学反応によると言える。



100 µm

 Fig.12
 UV の連続照射下で TiO₂/SiO₂表面に 接着した細胞のギムザ染色像

Fig.12に相当する免疫染色像をFig.13に示す。 ここから単位周囲長あたりの接着斑数を求めた (Fig.14)。TiO2ではUVを連続照射すると、単位 周囲長あたりの接着斑数は減少した。この結果 からも、UV 照射下のTiO2表面は、細胞が基板 に接着しにくい状態になっていると言える。



100 µm





接着斑数

24 h 培養の終了 0.5 h 前, 2 h 前から UV を照 射した際の細胞のギムザ染色像をFig.15 に示す。 これらから光学顕微鏡を利用して細胞密度を求 めた(Fig.16)。SiO2 では,終了直前に UV を照 射すると細胞数は減少した。また,UV 照射時間 が長くなると,その減少量は大きくなった。これ は、UV の直接照射により細胞がダメージを受け たことによると思われる。一方,TiO2 でも UV 照 射によって同様の細胞密度の減少が認められた。 さらにこれらには有意な差があった。TiO2/SiO2 の細胞培養器では、TiO2層が UV を吸収してし まうため、細胞に UV は照射されない。したがっ て、この細胞密度の減少は、TiO2の光化学反応 によると言える。この細胞密度の減少は、暗所下 で増殖した細胞が剥離したことを示している。



Fig.15 培養終了直前にUV 照射した TiO2/SiO2表面における細胞のギムザ染色像



(3) TiO, への Nb ドーピング

TiO₂と同様の手法で Nb を添加した TiO₂膜が 合成できた。XRD プロファイルでは、TiO₂ピーク の低角シフトが観察されたので、Ti サイトを Nb で置換できていると判断した。光透過スペクトル においても、わずかであるが可視光吸収性が現 れた。

(4) まとめ

本研究では,純Ti上にTiO₂を成膜し,上方からUVを照射する細胞培養器,SiO₂上にTiO₂を成膜し,下方からUVを照射する細胞培養器を 作製し,細胞の接着・増殖・剥離に及ぼすTiO₂の光化学反応の影響を調査した。その結果, TiO₂の光化学反応を利用した(i)細胞の接着 抑制,(ii)細胞の接着促進,ならびに(iii)接着し た細胞の剥離が可能であることが示された。これ らの原理の利用は、細胞シートの作製や細胞の 3D プリンティング技術に応用できると考えてい る。

5. 主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

[学会発表](計8件)

- 上田正人,池田勝彦,山本彩乃,松垣あいら,中野貴由,背面照射型のTiO₂/SiO₂光応 答細胞培養器の試作,日本金属学会,東京 理科大学(東京),2016.3.25.
- (2) C. Fujita, Y. Yoshida, <u>M. Ueda</u>, M. Ikeda, Synthesis of TiO₂ Film on Ti and Application to Photo-Responsive Cell Culture Vessels, International Symposium on EcoTopia Science, Nagoya University (Aichi), Japan, 2015.11.28.
- ③上田正人,池田勝彦,吉田和加,藤田智香, 松垣あいら,中野貴由,酸化チタンの光化学 反応を利用した細胞培養器の試作,日本バ イオマテリアル学会,京都テルサ(京都), 2015.11.9.
- ④ 上田正人,池田勝彦,吉田和加,松垣あいら,中野貴由,酸化チタン表面の細胞接着挙動における紫外線照射効果,日本金属学会,九州大学(福岡),2015.9.18.
- (5) <u>M. Ueda</u>, Y. Yoshida, M. Ikeda, A. Matsugaki, T. Nakano, Adhesion/Proliferation of Cells on TiO₂ under UV Irradiation, 27th European Conference on Biomaterials, ICE Krakow (Krakow), Poland, 2015.8.31-2015.9.2.
- (6) <u>M. Ueda</u>, Y. Yoshida, M. Ikeda, Adhesion of Cells on Titanium Dioxide under UV Irradiation, The 13th Japan and Korea International Symposium on Recourses Recycling and Materials Science, Kyoto Garden Palace (Kyoto), Japan, 2015.5.14.
- ⑦ 上田正人,池田勝彦,湿式合成した TiO2表面の HAp 形成に及ぼす熱処理と光照射の影響,日本金属学会,名古屋大学(愛知),2014.9.25.
- (8) <u>M. Ueda</u>, M. Kato, M. Ikeda, Formation of Hydroxyapatite on TiO₂ and ZrO₂ in Simulated Body Fluid under UV Irradiation, The 12th Korea/Japan International Symposium on Resources Recycling and Materials Science, KIGAM (Daejeon), Korea, 2014.4.17-19.

[その他]

http://www.chemmater.kansai-u.ac.jp/ecmate/

6. 研究組織

(1) 研究代表者
 上田 正人(UEDA, Masato)
 関西大学・化学生命工学部・准教授
 研究者番号:40362660